

香川高等専門学校		開講年度	令和02年度 (2020年度)		授業科目	知的財産権		
科目基礎情報								
科目番号		202008		科目区分		工学基礎 / 選択		
授業形態		講義		単位の種別と単位数		学修単位: 2		
開設学科		創造工学専攻（機械電子工学コース） （2023年度以前入学者）		対象学年		専1		
開設期		後期		週時間数		2		
教科書/教材		未定						
担当教員		中井 博,川村 昌也						
到達目標								
知的財産権制度および各権利に関する基礎的知識を習得する。 特許情報の調査および技術の把握と、技術を文章化する能力を得る。								
ルーブリック								
		理想的な到達レベルの目安		標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安		
評価項目1		知的財産権の各権利を理解し、各保護対象を区別して説明できる。		知的財産権の各権利の保護対象を説明できる。		知的財産権の各権利の保護対象を説明できない。		
評価項目2		特許情報に関する調査ができる。 また、複数の特許文献に記載されている技術の相違が説明ができる。		特許情報に関する調査ができる。 文献に記載されている技術を理解できる。		特許情報に関する調査ができない。 または、文献に記載されている技術を理解ができない。		
評価項目3		技術内容の特徴を知的財産として把握できる。		技術内容の特徴を把握できる。		技術内容の特徴の把握ができない。		
学科の到達目標項目との関係								
学習教育目標 A-1								
教育方法等								
概要		知的財産権制度および各権利に関する基礎的知識および実務に関する経験を得るために、教科書および配布資料による講義や演習を行い課題を与える。						
授業の進め方・方法		教科書および配布資料に基づいて、知的財産制度と各権利を講義する。 特許調査および技術の把握の能力を得るために、演習課題を与える。						
注意点								
授業計画								
		週	授業内容		週ごとの到達目標			
後期	3rdQ	1週	ガイダンス 知的財産権制度の体系		知的財産権の体系を理解する。			
		2週	特許、実用新案、意匠、商標の各制度の目的と制度の概要		特許、実用新案、意匠、商標の各制度の相違を把握する。			
		3週	特許法および実用新案法の概要		特許、実用新案の制度および権利の概要を説明する。			
		4週	特許を受ける権利と職務発明 特許要件（先願・出願書類）		特許受ける権利と正しい発明者特定の見え方・職務発明制度、特許取得の手続きを把握する。			
		5週	特許要件（特許法上の発明） （産業上の利用可能性） （不特許事由）		特許法の保護対象を理解する。			
		6週	特許要件（新規性） （進歩性）		新規性・進歩性の意味と、ケースに応じこれらが認められるか否かが判断する。			
		7週	特許取得に向けた審査・審判制度		審査・審判制度の概要と対応方法が理解できる。			
		8週	特許文献の調査演習と技術内容把握		特許文献の調査手法を取得する。調査のための技術内容を把握するスキルを得る。			
	4thQ	9週	特許権の効力 特許権の財産性と実施権		特許権の効力、限界を把握する。			
		10週	特許書類作成演習		特許書類と権利の関係について理解する。			
		11週	特許権侵害と救済 外国出願制度		特許権侵害のケースにおける対応方法を理解する。外国出願制度の概要を理解する。			
		12週	意匠法		意匠制度を理解する。			
		13週	商標法		商標制度を理解する。			
		14週	著作権法 不正競争防止法		著作権法、不正競争防止法を理解する。			
		15週	知的財産の事例紹介		知的財産権の実例に基づいて実際の知的財産の役割・活用について理解する。			
		16週	期末試験					
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標								
分類		分野	学習内容	学習内容の到達目標			到達レベル	授業週
評価割合								
		試験		レポート		合計		
総合評価割合		50		50		100		
評価項目1		50		10		60		
評価項目2		0		20		20		
評価項目3		0		20		20		